

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: MATSUMOTO, Y. et al.

Serial No.: Herewith

Group Art Unit: TBD

Filed: August 30, 2000

Examiner: TBD

Title: REACTOR FOR CATALYTIC GAS PHASE OXIDATION



SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

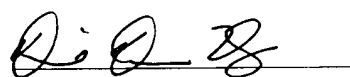
Honorable Commissioner of Patents
and Trademarks
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Enclosed are copies of Japanese Priority Document Nos. 11-246057 and 11-246058 for the above-described application. Accordingly, the claim for priority under 35 U.S.C. § 119 is satisfied.

It is believed that no fee is required. If any additional fees are required, the Commissioner is authorized to charge Deposit Account No. 13-2165.

Respectfully submitted,


Diane Dunn McKay
Reg. No. 34,586
Attorney for Applicant

DATE: August 30, 2000

Mathews, Collins, Shepherd & Gould
100 Thanet Circle, Suite 306
Princeton, NJ 08540-3662
(609) 924-8555

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

JCS42 U.S. PTO
09/652209
08/30/00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1 9 9 9 年 8 月 3 1 日

出 願 番 号
Application Number:

平成 1 1 年特許願第 2 4 6 0 5 8 号

出 願 人
Applicant (s):

株式会社日本触媒

2 0 0 0 年 7 月 2 1 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造

出証番号 出証特 2 0 0 0 - 3 0 5 6 7 5 2

【書類名】 特許願

【整理番号】 99P0402

【提出日】 平成11年 8月31日

【あて先】 特許庁長官 伊佐山 建志 殿

【国際特許分類】 B01J 23/88
C07C 47/22

【発明の名称】 接触気相酸化反応器

【請求項の数】 9

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖 9 9 2 番地の 1 株式会
社日本触媒内

 【氏名】 松本 行弘

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖 9 9 2 番地の 1 株式会
社日本触媒内

 【氏名】 森 正勝

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖 9 9 2 番地の 1 株式会
社日本触媒内

 【氏名】 北浦 正次

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖 9 9 2 番地の 1 株式会
社日本触媒内

 【氏名】 百々 治

【発明者】

 【住所又は居所】 兵庫県姫路市網干区興浜字西沖 9 9 2 番地の 1 株式会
社日本触媒内

 【氏名】 谷本 道雄

【特許出願人】

【識別番号】 000004628

【氏名又は名称】 株式会社日本触媒

【代理人】

【識別番号】 100072349

【弁理士】

【氏名又は名称】 八田 幹雄

【電話番号】 03-3230-4766

【選任した代理人】

【識別番号】 100102912

【弁理士】

【氏名又は名称】 野上 敦

【選任した代理人】

【識別番号】 100110995

【弁理士】

【氏名又は名称】 奈良 泰男

【選任した代理人】

【識別番号】 100111464

【弁理士】

【氏名又は名称】 齋藤 悦子

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001719

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 接触気相酸化反応器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 熱媒を半径方向に導入または導出する複数の環状導管が外周に配置されかつ原料供給口と生成物排出口とを有する円筒状反応器シェルと、
該複数の環状導管を互いに接続する循環装置と、
該反応器を複数の管板によって拘持される複数の反応管と、
該反応器シェルに導入された熱媒の方向を変更するための穴あき円板型邪魔板と円板型邪魔板とを該反応管の長手方向に有する多管式反応器において、
該反応管が、該反応管外径の 1.2 ～ 1.4 倍の中心間隔で拘持され、反応器シェル中央に反応管を配列しない空間部を有し、かつ穴あき円板型邪魔板が支持しない反応管を有することを特徴とする接触気相酸化反応器。

【請求項 2】 更に、該円板型邪魔板が支持しない反応管を有することを特徴とする請求項 1 に記載の反応器。

【請求項 3】 該空間部の断面積が、該反応器シェル断面積の 0.5 ～ 5 %、該円板型邪魔板の断面積が該反応器断面積の 50 ～ 95 %、かつ該穴あき円板型邪魔板の穴断面積が該反応器断面積の 2 ～ 25 %であることを特徴とする、請求項 1 または 2 に記載の反応器。

【請求項 4】 更に、反応器シェルから排出される該環状導管または循環装置の熱媒循環口に冷却後の熱媒導入口を有することを特徴とする、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の反応器。

【請求項 5】 更に、反応器シェル内に熱媒とともに導入されて溜まるガスを反応器シェル外に排出するためのガス排出導管を配設することを特徴とする、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の反応器。

【請求項 6】 更に、該環状導管は、熱媒が貫通する複数の開口列を有し、開口幅は該中心間隔の 5 ～ 50 %、さらに開口長／開口幅の値は 0.2 ～ 2.0 の範囲であることを特徴とする、請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の反応器。

【請求項 7】 該開口列の少なくとも 1 列は、2 以上の開口を有することを特徴とする、請求項 6 に記載の反応器。

【請求項 8】 (メタ) アクリル酸または (メタ) アクロレイン製造用である、請求項 1 ～ 7 のいずれかに記載の反応器。

【請求項 9】 請求項 1 ～ 8 のいずれかに記載の反応器を用いた、(メタ) アクリル酸および/または (メタ) アクロレインの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、穴あき円板型邪魔板が支持しない反応管を有する多管式反応器、および該反応器を用いる (メタ) アクリル酸または (メタ) アクロレインの製造方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術および発明が解決しようとする課題】

多管式反応器を使用する接触気相酸化反応は、該反応によって生じた熱を効率よく除去するために一般に使用される手段である。反応器シェル内に複数の反応管を内蔵する多管式反応器を用い、該反応管内には触媒を充填させて反応原料ガスを供給して接触気相酸化反応を行う一方、反応管シェル内に反応熱を吸収する熱媒を循環させて、生じた反応熱を除去させる。

【 0 0 0 3 】

しかしながら、このような多管式反応器を使用する接触気相酸化反応においては、原料入口側にホットスポットを生じやすく、過度の発熱反応による触媒の劣化や目的生成物の選択率の低下が問題となる。

【 0 0 0 4 】

この様な問題を解決するため、例えば、特公昭 5 2 - 1 5 2 7 2 号公報には、熱交換媒体の循環装置を備える多管式反応装置であって、反応器シェル内に邪魔板を配置した反応装置が開示されている。該邪魔板の存在により、一区域の中の横の流れの速さがほとんど一定に保たれ、これにより 1 つの区域の中の熱移行も一定にされる旨が開示されている。具体的には、該公報に示される反応器は、環状に配置された直立した反応管が反応器シェル内に内蔵され、反応管の上下端が管板に密封して取り付けられたものであって、反応管には横方向に間隔をおいて

複数の水平な穴あき円板型邪魔板と円板型邪魔板とが交互に中央および外方の縁に通過断面を作っている。なお、反応器シェルの中央には円板型邪魔板を取りつけるためのタイロッドおよびスペーサーが設けられている。

【 0 0 0 5 】

ここに、従来の穴あき円板型邪魔板と円板型邪魔板とを内蔵する多管式反応管の概略を図 1 に示すが、通常、反応器シェル 1 の中央には、円板型邪魔板 3 を連結するためのタイロッドおよびスペーサー 7 が配置されている。これに他のタイロッドおよびスペーサーを介して穴あき円板型邪魔板 2 が接続され、各邪魔板に設けられた貫通口に反応管 4 が接続され、この邪魔板に接続した反応管が反応器シェル 1 内に内蔵されている。また、図に示さない軸流ポンプなどにより熱媒 1 0 が環状導管 1 1 a を介して反応器シェル 1 内に導入される。導入された熱媒 1 0 は、穴あき円板型邪魔板 2 と円板型邪魔板 3 とによって方向を変更しつつ、反応器シェル 1 内を移動する。すなわち、熱媒 1 0 の移動は反応管を除熱するためのものであり、熱媒 1 0 の流路を確保するために邪魔板が必要とされ、これにより反応管が均一に除熱される。この場合、反応管 4 は穴あき円板型邪魔板 2 によって必ずフルサポートされている。フルサポートしない場合には、穴あき円板型邪魔板 2 の中央穴部から熱媒 1 0 の昇降流が発生し、反応管 4 の均一的な熱除去が不十分となるからである。しかしながら、熱媒の横移動が多いことは、熱媒の圧力損失の増大を招き、過大な動力エネルギーが必要となる。

【 0 0 0 6 】

一方、反応器シェルに導入される熱媒は、反応管の除熱後に反応器シェル外に排出され、熱交換器などで冷却されて反応器シェルに循環使用される。例えば、特開平 8 - 9 2 1 4 7 号公報には、多管式反応器を用いて特定の選択率と変換率を維持しつつプロペンをアクロレインへと接触気相酸化する方法において、熱交換剤を並流で導通すると共に反応容器内に邪魔板を配置し、反応器中の熱媒の温度上昇が 2 ~ 1 0 °C となるよう熱交換剤の流速を調整する接触気相酸化方法が開示されている。該公報に記載の方法によれば、ホットスポット温度を減少しつつ多管式反応器中で温められた温度で触媒活性の複合金属酸化物を用いてプロペンを接触気相酸化してアクロレインが得られる旨が開示されている。

【 0 0 0 7 】

しかしながら、熱収率は反応によって発生する熱量と冷却による消費熱量の収支によって算出される。しかも、ホットスポット温度は、多数の反応管のなかで最も高い熱量となる箇所が律速となる。したがって、反応熱を除去するために反応器シェル側に熱媒を導入しても、反応熱の除去が反応管の全体にわたって均一に行われなければ反応管の過度の温度上昇が起こり、副反応が増加し収率の低下、触媒の劣化加速、さらに暴走反応の危険性を否定できない。この点、特開平 8 - 9 2 1 4 7 号公報に記載される実施例でも明らかなように、発生熱量が同一の条件では、熱媒を反応器シェル内で向流で流しても並流で流しても、該熱媒の温度上昇を 1℃ に制限するために必要なポンプ動力は、全く同じ結果となる。したがって、各反応管のホットスポット温度を均一に減少させるための効率的な手段が求められる。

【 0 0 0 8 】

更に、反応器シェルへの熱媒の導入に伴いガスが反応器シェル内に導入される場合がある。熱媒は、反応管の除熱に伴う加熱と、その後の冷却など多大の温度変化を蒙るため、膨張と収縮にともないガスを内在させやすく、これが反応器シェルに溜まるのである。一般に、反応器使用開始時に熱媒を反応器シェルに導入する場合には、ガス抜き口を開口させて熱媒の導入を容易にするが、反応器使用時にはこれを閉じて使用するためガスが反応器上部に溜まる。このため、ガス溜まりには熱媒が存在せず、反応管の除熱が十分に行えない。また、ガスによって反応管が腐食する場合もある。

【 0 0 0 9 】

このように、従来の多管式反応器は、反応管の熱除去を行うために邪魔板の配置、特定流速の熱媒の循環使用などを行っているが、反応管の除熱は十分なものとはいえない。また、このような多管式反応器を使用して工業的に目的物を生産する場合には、目的たる生成物の収率と消費電力とを調和させることも重大な課題である。特に、多管式反応器による熱除去を効率よく行うために循環させる熱媒量を増大させれば、最終的に熱媒を循環させる動力エネルギーの増大につながり不利である。また、反応管を細管化して伝熱面積を大きくすれば、反応管本数

の増大を招き反応装置を高価なものとする。

【0 0 1 0】

従って、目的生成物の選択率を維持しつつ、熱の均一な除去を行いホットスポット温度を減少させ、かつ動力エネルギーの低減が達成できる反応器の開発が求められる。

【0 0 1 1】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、反応器内の熱媒の移動を詳細に検討した結果、穴あき円板型邪魔板の内側にも反応管を配設した場合に、反応器を小型化することができ、かつ目的生成物の収率も従来と相違ないことを見出し、本発明を完成させた。

【0 0 1 2】

即ち、上記課題は、以下の（１）～（９）によって達成される。

【0 0 1 3】

（１） 熱媒を半径方向に導入または導出する複数の環状導管が外周に配置されかつ原料供給口と生成物排出口とを有する円筒状反応器シェルと、

該複数の環状導管を互いに接続する循環装置と、

該反応器を複数の管板によって拘持される複数の反応管と、

該反応器シェルに導入された熱媒の方向を変更するための穴あき円板型邪魔板と円板型邪魔板とを該反応管の長手方向に有する多管式反応器において、

該反応管が、該反応管外径の 1. 2 ～ 1. 4 倍の中心間隔で拘持され、反応器シェル中央に反応管を配列しない空間部を有し、かつ穴あき円板型邪魔板が支持しない反応管を有することを特徴とする接触気相酸化反応用反応器。

【0 0 1 4】

（２） 更に、該円板型邪魔板が支持しない反応管を有することを特徴とする上記（１）に記載の反応器。

【0 0 1 5】

（３） 該空間部の断面積が、該反応器シェル断面積の 0. 5 ～ 5 %、該円板型邪魔板の断面積が該反応器断面積の 5 0 ～ 9 5 %、かつ該穴あき円板型邪魔板の穴断面積が該反応器断面積の 2 ～ 2 5 %であることを特徴とする、上記（１）

または（２）に記載の反応器。

【００１６】

（４） 更に、反応器シェルから排出される該環状導管または循環装置の熱媒循環口に冷却後の熱媒導入口を有することを特徴とする、上記（１）～（３）記載の反応器。

【００１７】

（５） 更に、反応器シェル内に熱媒とともに導入されて溜まるガスを反応器シェル外に排出するためのガス排出導管を配設することを特徴とする、上記（１）～（４）のいずれかに記載の反応器。

【００１８】

（６） 更に、該環状導管は、熱媒が貫通する複数の開口列を有し、開口幅は該中心間隔の５～５０％、さらに開口長／開口幅の値は０．２～２０の範囲であることを特徴とする、上記（１）～（５）のいずれかに記載の反応器。

【００１９】

（７） 該開口列の少なくとも１列は、２以上の開口を有することを特徴とする、上記（６）に記載の反応器。

【００２０】

（８） （メタ）アクリル酸または（メタ）アクロレイン製造用である、上記（１）～（７）のいずれかに記載の反応器。

【００２１】

（９） 上記（１）～（８）のいずれかに記載の反応器を用いた、（メタ）アクリル酸および/または（メタ）アクロレインの製造方法。

【００２２】

【発明の実施の形態】

本発明は、熱媒を半径方向に導入または導出する複数の環状導管が外周に配置されかつ原料供給口と生成物排出口とを有する円筒状反応器シェルと、該複数の環状導管を互いに接続する循環装置と、該反応器を複数の管板によって拘持される複数の反応管と、該反応器シェルに導入された熱媒の方向を変更するための穴あき円板型邪魔板と円板型邪魔板とを該反応管の長手方向に有する多管式反応器

において、該反応管が、該反応管外径の 1.2 ～ 1.4 倍の中心間隔で拘持され、反応器シェル中央に反応管を配列しない空間部を有し、かつ穴あき円板型邪魔板が支持しない反応管を有することを特徴とする接触気相酸化反応用反応器である。

【0023】

従来は、邪魔板は熱媒の流路を確保するものであり、フルサポートしないと昇降流が発生して熱効率が低下するため、反応管は、全て穴あき円板型邪魔板にフルサポートされていた。しかしながら、穴あき円板型邪魔板の内側にも反応管を配設したところ、目的生成物の収率、目的生成物の選択率を維持しつつ、熱媒を流動させる動力エネルギーを低減させ、かつ収納反応管に対する反応器の断面積を小型化することができたのである。以下、本発明の態様を図 2 を用いながら説明する。

【0024】

本発明は、熱媒を半径方向に導入または導出する複数の環状導管 11a、11b が外周に配置されかつ原料供給口 50 と生成物排出口 51 とを有する円筒状反応器シェル 1 と、該反応器シェル 1 の原料供給口 50 と生成物排出口 51 とを仕切る 2 枚の管板 6a、6b によって拘持される複数の反応管 4 と、該反応器シェル 1 に導入された熱媒の方向を変更するための穴あき円板型邪魔板 2 と円板型邪魔板 3 とを該反応管の長手方向に有する多管式反応器である。

【0025】

該穴あき円板型邪魔板 2 と円板型邪魔板 3 とは、反応管 4 の長手方向に交互に配置されるが、穴あき円板型邪魔板 2 と円板型邪魔板 3 との間隔は特に限定されない。従って、反応管のホットスポットが反応させる接触気相酸化反応によって異なる場合に、ホットスポットの位置やホットスポットの温度変化等に応じて適宜選択することができる。

【0026】

一方、該反応管 4 は、該反応管外径の 1.2 ～ 1.4 倍の中心間隔で配置されることが必要であり、より好ましくは 1.25 ～ 1.35 倍、特に好ましくは 1.25 ～ 1.30 倍である。反応管外径の 1.2 倍を下回ると反応管の間隔が狭

くなり、反応器の小型化には有用であるが中心付近の反応管における熱除去効率が低下するため、ホットスポット温度を減少することが困難となるからである。その一方、1.4倍を越えると反応器が大型化するとともに、シェル内の線速が低下し、および熱媒の偏流をきたし、熱媒除去効率が低下するからである。ただし、内蔵する反応管自体の内径および外径さらに反応管長について、特に制限はない。したがって、公知の接触酸化反応に使用される反応管のサイズを選択することができる。本発明では、反応管は、熱除去効率の点から内径15～50mmであることが好ましく、より好ましくは20～40mm、特に好ましくは20～30mmである。

【0027】

また、本発明では、反応器シェルの中央部に空間部を有すると共に、穴あき円板型邪魔板2に支持されない反応管4aを有する点に特徴がある。従来は、反応器シェル中央にタイロッドおよびスペーサーを有する場合があります、かつ上記のごとく穴あき円板型邪魔板2によって全ての反応管4が支持されるものであったが、穴あき円板型邪魔板2の内側にも、図2に示す反応管4aを少なくとも1列以上配置することで、同一の反応器シェル径の反応管収納数を増大させることができ、同時に熱媒の動力エネルギーを低減でき、しかも従来と相違ない熱除去効率を確保することができたのである。この理由の詳細は不明であるが、中央部の空間部と穴あき円板型邪魔板2に支持されない反応管の配設とによって熱媒の圧力損失を減少させ、これが動力エネルギーの低減につながり、かつ線速が向上したために熱交換率が向上し、従来と相違ないホットスポット温度の減少、選択率の確保が可能となったと考えられる。

【0028】

この空間部断面積は、反応器シェル断面積に対して0.5～5%であることが好ましく、より好ましくは1～4%、特に好ましくは1～2%である。0.5%を下回ると中心部まわりの熱媒の流動が悪く、反応管の除熱が不十分となり、ホットスポット温度を減少できない。その一方、5%を越えると反応器シェル径が大きくなるとともに、線速の減少により熱効率が低下するからである。なお、反応器シェル1の中央部等のタイロッドに代えて、穴あき円板型邪魔板2や円板型

邪魔板 3 を固定するためのタイロッドおよびスペーサーを、穴あき円板型邪魔板 2 を貫通するように他に複数設けることもできる。

【 0 0 2 9 】

また、該円板型邪魔板 3 の断面積は、該反応器シェル 1 内の断面積の 5 0 ~ 9 5 % であることが好ましく、より好ましくは 6 0 ~ 9 0 %、特に好ましくは 7 0 ~ 8 5 % である。5 0 % を下回ると、反応器シェル壁面付近の熱媒流動が悪く熱効率が低下し、9 5 % をこえると動力エネルギーが増大すると共に円板型邪魔板付近の熱媒の流動が悪くなり熱効率が低下するからである。

【 0 0 3 0 】

また、該穴あき円板型邪魔板 2 の穴断面積は、該反応器シェル内の断面積の 2 ~ 2 5 % であることが好ましく、より好ましくは 4 ~ 2 0 % であり、特に好ましくは 6 ~ 1 8 % である。2 % を下回ると、熱媒の圧力損失を増大させ、2 5 % を上回ると均一な熱除去が困難となるからである。

【 0 0 3 1 】

本発明は、該穴あき円板型邪魔板 2 が支持しない反応管 4 a を有するものであるが、図 2 に示すように同時に該円板型邪魔板が支持しない反応管 4 b を有していてもよい。このような反応管 4 b を配設することで反応器シェル 1 内に配設される反応管数を増大させることができる。しかも、特定割合の該中央部の空間部、該穴あき円板型邪魔板の穴面積、該円板型邪魔板面積の選択と相俟って、ホットスポット温度の低減、目的生成物の収率の確保が可能となったのである。

【 0 0 3 2 】

なお、これらの邪魔板は、ホットスポットの位置と重ならないように配設することが好ましく、より好ましくは 1 0 0 m m 以上、特に好ましくは 2 0 0 m m 以上離して配設する。反応管のホットスポット位置と邪魔板支持部とが重なると熱媒による熱除去の効率が低下し、ホットスポット温度の減少が困難となるからである。このようなホットスポット位置は、予め触媒を充填した反応管に原料ガスなどを供給して反応管各所の温度を測定することで、ホットスポット位置を知ることができる。なお、反応の進行に伴いホットスポット位置が変更する場合には、その変更域を考慮して邪魔板を配設すればよい。

【 0 0 3 3 】

本発明の反応器においては、熱媒 1 0 の全部または一部は、環状導管 1 1 a または 1 1 b に設けられた熱媒排出口から反応器シェル 1 外に排出され、環状導管 1 1 a と 1 1 b との間に設けられた循環装置を介して、他の環状導管 1 1 b または 1 1 a から反応器シェル 1 内に循環される。このような循環装置を有する場合、穴空き円板型邪魔板 2 と円板型邪魔板 3 とによって流路を確保された熱媒 1 0 が反応器下部から上部に向けてアップフローで導入される場合の該反応装置の熱媒 1 0 の流れについて図 3 を用いて説明する。

【 0 0 3 4 】

まず、環状導管 1 1 a から導入され、環状導管 1 1 b から排出された熱媒 1 0 の内、反応器シェル 1 および循環装置 3 0 外に取り出されずに直ちに循環装置 3 0 の熱媒排出口 3 4 に向かう熱媒（これを熱媒 1 0 a とする）は、環状導管 1 1 b に設けられた熱媒循環口 3 1 から循環装置 3 0 に導入され、熱媒排出口 3 4 を経て環状導管 1 1 a に導入され、反応器シェル 1 内に循環される。

【 0 0 3 5 】

一方、熱媒 1 0 の一部は、環状導管 1 1 b に設けられた熱媒取り出し口 1 2 から反応器シェル 1 外に取り出され、図示しない熱交換器で冷却され、循環装置 3 0 の熱媒循環口 3 1 と対峙して設けられた熱媒導入口 3 2 から導入される。熱媒 1 0 の反応器シェル外への排出は、環状導管 1 1 b を介するにと止まらず、例えば、図 4 に示すごとく、環状導管 1 1 b から熱媒循環口 3 1 をへて循環装置 3 0 に入った後に、循環装置 3 0 の上部に設けられた熱媒取り出し口 1 2 から反応器シェル 1 外に取り出され、図示しない熱交換器で冷却された後、環状導管 1 1 b に設けられた熱媒導入口 3 2 から導入させてもよい。この様に、反応器シェル外に取り出し、冷却後に環状導管 1 1 b または循環装置 3 0 の熱媒循環口 3 1 近傍に冷却後の熱媒 1 0 b を循環させると、循環装置 3 0 内の熱媒 1 0 a と熱媒 1 0 b との供給部とが隣接するため両者の混合が容易となる。また、図 4 に示す熱媒取り出し口 1 2 から取り出した熱媒を、例えば環状導管 1 1 b を介して反応器シェル内に循環させることもできる。この場合には、環状導管 1 1 b 内で混合させるための滞留時間を十分にとる必要があり、環状導管 1 1 b の部分でも、熱媒循

環口 3 1 と対峙した位置に熱媒導入口 3 2' を設けることが好ましい。環状導管 1 1 b に冷却後の熱媒 1 0 b を導入する場合の熱媒導入口 3 2 を 3 2' として図 4 に示す。なお、この場合には図 4 に示す熱媒導入口 3 2 は存在しない。この様に、本発明の反応器は、冷却後の熱媒 1 0 b を反応器シェル 1 または循環装置 3 0 に導入するための熱媒導入口 3 2 を、環状導管 1 1 b または循環装置 3 0 の熱媒循環口 3 1 近傍に有することが好ましい。循環装置 3 0 の熱媒排出口 3 4 近傍に冷却後の熱媒 1 0 b を循環させると、熱媒の 1 0 a と 1 0 b との混合が不十分となり、反応器シェル 1 内に循環される熱媒 1 0 の温度分布が不均一で、反応管 4 の局所的な異常高温が発生し易かった。本発明によれば、上記のごとく循環装置 3 0 の内で、熱媒循環口 3 1 に冷却後の熱媒（熱媒 1 0 b）を供給すること、または環状導管 1 1 b の一部に熱媒導入口 3 2 を設けることで、熱媒 1 0 a と熱媒 1 0 b とが極めて効率的に混合される。しかも、循環装置 3 0 内を移動する間に行われる吸熱量は極わずかであって、十分に熱媒として反応熱の除去を行うことが出来る。加えて、温度分布が均一な熱媒 1 0 を使用することで、ホットスポットの異常高温を均一に防止することができ、循環熱媒量も減少することができる。

【 0 0 3 6 】

なお、本発明における冷却後の熱媒 1 0 b を導入する熱媒導入口 3 2 を循環装置 3 0 内に設ける場合には、図 3 に示すように熱媒循環口 3 1 と対峙させた位置が例示できるが、後述する図 4 の態様に示すように、循環装置 3 0 の上部に熱媒取り出し口 1 2 を有する場合には、熱媒循環口 3 1 と対峙させた位置から熱媒 1 0 b を導入すると、冷却した熱媒 1 0 b の一部が熱媒取り出し口 1 2 から反応器外に出ていくため熱効率の点で不利である。この様な場合には、循環装置 3 0 内の熱媒循環口 3 1 と最も近い位置であって、かつ循環装置から熱媒を反応器シェルに排出するための熱媒の出口である熱媒排出口 3 4 と最も遠い位置が例示できる。また、循環装置内に複数の熱媒循環口 3 1 を有する場合には、その何れの近傍に熱媒 1 0 b を導入させてもよい。何れにおいても、熱媒 1 0 b と熱媒 1 0 a との混合が効率よく行われるからである。

【 0 0 3 7 】

また、本発明においては、循環装置の熱媒循環口と接続する反応器出口側環状導管の一部に熱媒導入口 3 2 を設けることもできる。この様にすれば、循環装置 3 0 に導入される際に既に熱媒 1 0 a と 1 0 b とが混合され、循環装置 3 0 内の熱分布の均一な熱媒 1 0 の調製が容易だからである。かかる場合、熱媒導入口 3 2 の位置は、環状導管内での混合後の滞留時間を十分にとれるように、循環装置 3 0 と対峙させた位置であることが好ましい。

【 0 0 3 8 】

なお、図 4 に示すように熱媒をアップフローで循環させる場合には、ポンプ 3 3 を使用して循環装置 3 0 の上部に設けた熱媒取り出し口 1 2 から取り出すことができる。この場合、その下部に設けた熱媒導入口 3 2 から導入される熱媒 1 0 b と混合しないように、仕切板 3 7 を設けることが好ましい。

【 0 0 3 9 】

本発明の反応器は、循環装置 3 0 内には熱媒 1 0 a と熱媒 1 0 b とを効率よく混合するためポンプ 3 3 の代わりに又は攪拌翼を有していてもよく、また配設してもよい。これにより更に効率よく均一な熱分布の熱媒が得られるからである。このようにして均一な熱分布となった熱媒 1 0 (熱媒 1 0 a + 熱媒 1 0 b) は、循環装置 3 0 の熱媒排出口 3 4 を経て、再度環状導管 1 1 a から反応器シェル 1 に導入される。尚、図中で熱媒 1 0 (1 0 a + 1 0 b)、熱媒 1 0 a、熱媒 1 0 b の流れを、その流路を示す矢印の上に各記号を付記して示した。

【 0 0 4 0 】

本発明では、反応器シェル 1 外に取り出された熱媒 1 0 b は、該熱交換の前後のいずれかにおいて気液分離することが好ましい。気泡が含まれる熱媒 1 0 b を使用すると、反応器シェル内で上部管板部にガス溜まりを生じ易く、かつ熱媒 1 0 a と熱媒 1 0 b との均一な混和は、脱気後の熱媒を使用することで容易に熱分布を均一にすることができるからである。この様な気液分離方法としては、速度の減少や液高さの確保によりガスの巻き込みを防止する方法が代表的であり、その他の方法でもよい。

【 0 0 4 1 】

本発明の反応器は、環状導管 1 1 a、1 1 b を有する。全周に亘り間欠的に連

通した開口部のある環状導管 11a、11b を介して反応器の全周方向から均等に熱媒が供給または排出されることで、均一に熱媒を供給しホットスポット温度の効率的な減少を行うことができるからである。この際、該環状導管には、熱媒が貫通する開口列を複数有することが好ましい。これを図 5 を用いて説明すると、例えば環状導管 11a には複数の開口列 A1、A2 等があり、各開口列の中心間隔 A は、各列毎に同一でも異なってもよく、50～500 mm、より好ましくは 100～400 mm、特に好ましくは 200～300 mm である。該中心間隔 A が 50 mm を下回ると、製作が困難となり、その一方 500 mm を越えると反応管外に均一に熱媒を送り込むことが困難となるからである。また、各開口列における開口数は、少なくとも 1 以上であり、図 5 では列 A1 は、開口数 1 個を示し、列 A2 は 2 個、列 An は 4 個の場合を示す。この様に各開口列に存在する開口数が異なるために、図 5 に示すように、隣接する開口と開口との間隔は上記中心間隔 A と一致しなくてもよい。また、開口幅 B は、該中心間隔の 5～50 %、より好ましくは 10～40 %、特に好ましくは 20～30 % とする。開口幅が 5 % を下回ると環状導管高さが高く大きくなり、その一方、50 % を越えると開口部高さが低く管の広域に亘り熱媒を送り込むことが困難となるからである。さらに、開口長 C / 開口幅 B の値は 0.2～2.0 の範囲が好ましい。なお、中心間隔 A は、環状導管の全てにおいて同一である必要はなく、同様に、開口幅 B も環状導管の全てにおいて同一である必要はない。複数の開口を設けることでより均一な熱媒 10 の排出入が可能となるからである。開口部の形状は、特に制限されず、例えば円、長円、楕円、矩形などを例示できる。

【0042】

なお、上記図 3 や図 4 に示す態様は、原料供給をアップフローで行うかダウンフローで行うかを問わず、熱媒 10 をアップフローで行う態様を示したが、本発明の反応器は接触気相酸化反応を行うに当たり、反応管 4 に導入される原料ガスは、アップフローでもダウンフローでも、特に制限なく使用できる。また、熱媒 10 も原料供給に対して並流でも向流でも特に制限なく導入することができる。

【0043】

また、本発明の反応器は、反応器シェル 1 の上部に溜まるガスを排出するため

のガス排出口を反応器シェル内の管板に密着させて配管することが好ましい。一般に、熱媒 1 0 の導入に際して反応器シェル 1 にガスが持ち込まれ、反応器シェル 1 の上部に熱媒が存在しない空間が生じやすいが、このようなガス溜まりには熱媒が存在しないために局部的に十分な除熱ができず、異常昇温が発生しやすい。したがって、該ガス排出口を設けることによってこのガスを除去し、熱媒で液満させて反応管の局所的な異常昇温を防止し、反応条件を安定化することができる。

【 0 0 4 4 】

次いで、本発明の反応器であって、熱媒の導入をダウンフローで行う場合について図 6 を用いて説明する。図 6 においても、穴あき円板型邪魔板 2 が支持しない反応管 4 a が反応器シェルの中央部に配設されている。また、循環装置 3 0 に冷却後の熱媒 1 0 b が熱媒導入口 3 2 から導入される。この場合、環状導管 1 1 a に設けた熱媒取り出し口 1 2 から排出された熱媒は、例えば、反応器シェル 1 の上方管板 6 b の上方に配設された熱媒排出ポット 1 3 まで押し上げられた後にノズル 1 4 から系外に排出される。この場合、熱媒排出ポット 1 3 により系外に排出された熱媒 1 0 b と同量の冷熱媒を、熱媒導入口 3 2 より供給する。これにより、反応器シェル 1 での熱媒 1 0 の満液状態を確保することができる。なお、上記反応器シェル外に取り出され、冷却した後に循環使用される熱媒 1 0 b と、熱媒循環口 3 1 から循環装置 3 0 に導入された熱媒 1 0 a (反応器シェル外に取り出されず直ちに循環使用される熱媒) とは、軸流ポンプまたは渦巻きポンプ等のポンプ 3 3 により混合されて上方に汲み上げられ、熱媒排出口 3 4 から反応器シェル 1 に環状導管 1 1 b をへて導入することができる。上記熱媒の導入量は、前記循環熱媒量の範囲で調整すればよい。

【 0 0 4 5 】

尚、本発明の反応器は、何れの態様においても、熱媒の反応シェル 1 側への供給およびシェル側からの排出は、反応器の上方及び下方の外周部に各々配置された環状導管 1 1 a、1 1 b を介して行うことができる。この場合、熱媒 1 0 の排出入は、環状導管 1 1 a、1 1 b の複数箇所で行ってもよく、このために 2 以上の循環装置を配設してもよい。単にポンプを増加しても温度分布の均一な熱媒を

調整することは困難であるが、本発明によれば循環装置内で均一な温度分布を有する熱媒が供給されるために、複数の循環装置の配設によって、更に効率的な熱除去が達成できるからである。

【 0 0 4 6 】

更に、本発明の反応器には、熱媒 1 0 b の熱媒取り出し口の前後に背圧付き手段を配設して反応管を流下する熱媒 1 0 に十分な背圧を付与して、満液状態を確保することができる。熱媒 1 0 b を反応器シェル 1 外部へ抜き取るに際し、反応器シェル 1 内部での熱媒 1 0 による満液状態が確保できることが好ましいが、背圧付き手段を配設することで、反応管を流下する熱媒に十分な背圧を付与して、満液状態を確保することができるからである。このような背圧付手段としては、抵抗オリフィス、弁、熱交換器等が例示できる。したがって、本発明の反応器にさらにこのような背圧付与手段を配置することができる。

【 0 0 4 7 】

また、図 6 の態様においても、反応器シェル 1 の上部に熱媒の供給時に同伴して導入されたガスが反応器シェル側内部に溜まる場合には、反応器シェル 1 の上部から反応器外周に施した配管 1 5 及び中央部まで差し込んだ配管 1 6 を介して熱媒排出ポット 1 3 や熱媒循環装置 3 0 の上方空間部に抜き出してもよい。このようなガス抜き出し用の導管により、反応器内での除熱を不均一にして異常反応を引き起こす要因となる反応器シェル 1 内のガス溜まり生成を防止することができるからである。例えば、図 6 に示すように、反応器シェル 1 の上部に配設したガス排出用導管 1 6 を反応器上管板面の上部に位置する熱媒排出ポット 1 3 の気相部に連通しガス排出口 1 7 より排出するか、反応器シェル 1 内のガス排出用導管 1 5 を、ガス排出用導管 3 6 を有した循環装置 3 0 の上方空間部に排出することができる。

【 0 0 4 8 】

図 7 は、ガス排出用導管の配設例を示したものであり、反応器の外周に溜まるガスに関して、例えば、1 5 の様に上部管板 6 b に流路を形成して反応器シェル 1 外に導通させてもよく、反応器シェル 1 の中央部に溜まるガスに関しては、上部管板 6 b の直下にガス排出用導管 1 6 を配設すればよい。

【 0 0 4 9 】

以下に、本発明の反応器によるプロピレンまたはイソブチレン含有ガスの接触気相酸化反応によて（メタ）アクリル酸または（メタ）アクロレインを生成する方法について図 2 を用いて説明する。

【 0 0 5 0 】

本発明の接触気相酸化反応は、反応管 4 内に充填した触媒 5 に原料ガスを供給して行うが、反応原料と空気等を混合した原料ガスは、原料ガス供給口 5 0 より反応器シェル 1 内の触媒 5 の充填された反応管 4 内に供給され、反応管内で酸化されて反応生成物となった後、生成ガス排出口 5 1 より排出される。

【 0 0 5 1 】

本発明でプロピレン含有ガスを二段接触気相酸化反応してアクリル酸を製造するには、例えば前段触媒として、プロピレンを含有する原料ガスを気相酸化反応してアクロレインを製造するに一般的に使用される酸化触媒を使用することができる。同様に、後段触媒についても特に制限はなく、二段階接触気相酸化法により前段によって得られる主としてアクロレインを含む反応ガスを気相酸化してアクリル酸を製造するに一般的に用いられている酸化触媒を用いることができる。

【 0 0 5 2 】

前段触媒としては、一般式 $M o^a - B i^b - F e^c - A d - B e - C f - D g - O^x$ ($M o$ 、 $B i$ 、 $F e$ はそれぞれモリブデン、ビスマスおよび鉄を表し、 A はニッケルおよびコバルトから選ばれる少なくとも一種の元素を表し、 B はアルカリ金属およびタリウムから選ばれる少なくとも 1 種の元素を表し、 C はリン、ニオブ、マンガン、セリウム、テルル、タングステン、アンチモンおよび鉛からなる群より選ばれた少なくとも 1 種の元素を表し、 D はケイ素、アルミニウム、ジルコニウムおよびチタニウムからなる群より選ばれた少なくとも 1 種の元素、 O は酸素を表し、 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 、 g および x は、それぞれ $M o$ 、 $B i$ 、 $F e$ 、 A 、 B 、 C 、 D および O の原子比を表し、 $a = 1 \sim 2$ としたとき、 $b = 0.1 \sim 1.0$ 、 $c = 0.1 \sim 1.0$ 、 $d = 2 \sim 2.0$ 、 $e = 0.001 \sim 5$ 、 $f = 0 \sim 5$ 、 $g = 0 \sim 3.0$ であり、 x は各元素の酸化状態により定まる値である) で示されるものが例示できる。

【0053】

また、後段触媒としては、一般式 $Mo^a - V^b - W^c - Cu^d - A^e - B^f - C^g - O^x$ (Mo はモリブデン、 V はバナジウム、 W はタングステン、 Cu は銅、 A はアンチモン、ビスマス、スズ、ニオブ、コバルト、鉄、ニッケルおよびクロムから選ばれる少なくとも一種の元素を表し、 B はアルカリ金属、アルカリ土類金属およびタリウムから選ばれる少なくとも1種の元素を表し、 C はケイ素、アルミニウム、ジルコニウムおよびセリウムから選ばれた少なくとも1種の元素を表し、 O は酸素を表し、 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 、 g および x は、それぞれ Mo 、 V 、 W 、 Cu 、 A 、 B 、 C および O の原子比を表し、 $a=12$ としたとき、 $b=2\sim14$ 、 $c=0\sim12$ 、 $d=0.1\sim5$ 、 $e=0\sim5$ 、 $f=0\sim5$ 、 $g=0\sim20$ であり、 x は各元素の酸化状態により定まる値である)で示されるものが例示できる。

【0054】

本発明でイソブチレン、 t -ブタノール、メチルー t -ブチルエーテルを二段接触気相酸化反応でメタクリル酸を得る場合に使用する触媒としては、例えば前段触媒としてイソブチレン等を含有する原料ガスを気相酸化反応してメタクロレインを製造するに一般的に使用される酸化触媒を使用することができる。同様に、後段触媒についても特に制限はなく、二段階接触気相酸化法により前段によって得られる主としてメタクロレインを含む反応ガスを気相酸化してメタクリル酸を製造するに一般的に用いられている酸化触媒を用いることができる。

【0055】

具体的には、前段触媒として、一般式 $Mo^a - W^b - Bi^c - Fe^d - A^e - B^f - C^g - D^h - O^x$ で表されるものが好ましい (Mo 、 W 、 Bi はそれぞれモリブデン、タングステンおよびビスマスを表し、 Fe は鉄を表し、 A はニッケルおよび/またはコバルトを表し、 B はアルカリ金属、アルカリ土類金属およびタリウムから選ばれる少なくとも1種の元素を表し、 C はリン、テルル、アンチモン、スズ、セリウム、鉛、ニオブ、マンガンおよび亜鉛からなる群より選ばれた少なくとも1種の元素を表し、 D はシリコン、アルミニウム、チタニウムおよびジルコニウムからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素を表し、 O は酸素

を表す。また、 a, b, c, d, e, f, g, h および x は、それぞれ $Mo, W, Bi, Fe, A, B, C, D$ および O の原子数を表し、 $a = 12$ としたとき、 $b = 0 \sim 10, c = 0.1 \sim 10, d = 0.1 \sim 20, e = 2 \sim 20, f = 0.001 \sim 10, g = 0 \sim 4, h = 0 \sim 30$ 、および x は各々の元素の酸化状態によって定まる数値をとる。)

また、後段触媒は、モリブデンおよびリンを主成分として含有する 1 種または 2 種以上の酸化物触媒であれば、特に限定はされないが、たとえば、リンモリブデン酸系ヘテロポリ酸あるいはその金属塩が好ましく、一般式 $Mo_a - P_b - A_c - B_d - C_e - D_f - O_x$ で表されるものが好ましい。(式中、 Mo はモリブデンを表し、 P はリンを表し、 A はヒ素、アンチモン、ゲルマニウム、ビスマス、ジルコニウムおよびセレンからなる群の中から選ばれた少なくとも 1 種の元素を表し、 B は銅、鉄、クロム、ニッケル、マンガン、コバルト、スズ、銀、亜鉛、パラジウム、ロジウムおよびテルルからなる群の中から選ばれた少なくとも 1 種の元素を表し、 C はバナジウム、タングステンおよびニオブからなる群の中から選ばれた少なくとも 1 種の元素を表し、 D はアルカリ金属、アルカリ土類金属およびタリウムからなる群の中から選ばれた少なくとも 1 種の元素を表し、 O は酸素を表す。また、 a, b, c, d, e, f および x はそれぞれ Mo, P, A, B, C, D および O の原子比を表し、 $a = 12$ と固定した時、 $b = 0.5 \sim 4, c = 0 \sim 5, d = 0 \sim 3, e = 0 \sim 4, f = 0.01 \sim 4$ および x は各々の元素の酸化状態により定まる数値である。)

触媒の形状についても特に限定されず、球状、円柱状、円筒状などとしてことができ、成形方法も担持成形、押し出し成形、打錠成形などを用いることができ、更に耐火用担体にこれらの触媒物質を担持させた形態のものも有用である。

【0056】

プロピレンやイソブチレンの分子状酸素による気相接触酸化反応の条件は、従来公知の方法で行うことができる。例えばプロピレンを例にとれば、原料ガス中のプロピレン濃度は 3～15 容量%、プロピレンに対する分子状酸素の比は 1～3 であり、残りは窒素、水蒸気、酸化炭素、プロパンなどである。

【0057】

分子状酸素の供給源としては空気が有利に用いられるが、必要により酸素富化空気、純酸素を用いることもでき、ワンパス法あるいはリサイクル法が用いられる。反応温度は $250^{\circ}\text{C}\sim 450^{\circ}\text{C}$ 、反応圧力は常圧から5気圧、空間速度 $500\sim 3000\text{ h}^{-1}$ (STP) の範囲で行うことが好ましい。

【0058】

また、イソブチレンの気相接触酸化反応の場合には、原料ガス中のイソブチレン濃度は1～10容量%、イソブチレンに対する分子状酸素の濃度は3～20容量%であり、水蒸気を0～60容量%、残りは窒素、水蒸気、酸化炭素などである。分子状酸素の供給源としては空気が有利に用いられるが、必要により酸素富化空気、純酸素を用いることもできる。反応温度は、 $250\sim 450^{\circ}\text{C}$ 、反応圧力は常圧から5気圧、空間速度 $300\sim 5000\text{ h}^{-1}$ (STP) の範囲で行うことが好ましい。

【0059】

次いで、アクリル酸を生成させるために上記酸化物触媒（後段触媒）をシェル内の管束部の各管に充填した熱交換型多管式第2反応器内に、前記の前段反応で得られたアクロレイン含有ガスに必要な応じて2次空気、2次酸素または水蒸気を追加してなる混合ガスを、反応温度（反応器熱媒温度） $100\sim 380^{\circ}\text{C}$ 、好ましくは $150\sim 350^{\circ}\text{C}$ および空間速度 $300\sim 5,000\text{ h}^{-1}$ (STP) で供給し、後段反応させて、アクリル酸を得るようにする。

【0060】

また、メタクリル酸を生成させるためにモリブデンおよびリンを含有する酸化物触媒（後段触媒）をシェル内の管束部の各管に充填した熱交換型多管式第2反応器内に、前記の前段反応で得られたメタクロレイン含有ガスに必要な応じて2次空気、2次酸素または水蒸気を追加してなる混合ガスを、反応温度（反応器熱媒温度） $100\sim 380^{\circ}\text{C}$ 、好ましくは $150\sim 350^{\circ}\text{C}$ および空間速度 $300\sim 5,000\text{ h}^{-1}$ (STP) で供給し、後段反応させて、メタクリル酸を得るようにする。

【0061】

本発明は、中間管板により上下のチャンバーを形成する形式の反応器にも適用

することができる。

【0062】

なお、本発明により、ベンゼンまたはブタンを原料ガスとして公知の触媒及び反応系によって無水マレイン酸を、キシレンおよび／またはナフタレンを原料ガスとして公知の触媒及び反応系によって無水フタル酸を製造することもできる。

【0063】

反応器シェル1に循環させる熱媒としては、従来公知の何れをも使用することができる、例えば溶融塩、ナイター、ダウサム系の有機熱媒であるフェニルエーテル系熱媒を使用することができる。

【0064】

本発明によれば、反応器シェル中央部の空間と、穴あき円板型邪魔板が支持しない反応管を配置することで、動力エネルギーを低減することができ、しかも目的生成物の選択率や収率をいじすることができる。しかも、反応管のホットスポットを均一に減少することができるため、触媒の劣化を効率よく防止でき、触媒寿命の延長を達成出来る。

【0065】

【実施例】

以下、本発明の実施例により具体的に説明する。

【0066】

(触媒の製造例)

純水150リットルを加熱攪拌しながらモリブデン酸アンモニウム100kgおよびパラタングステン酸アンモニウム6.3kgを溶解した。この液に別に硝酸コバルト68.7kgを20リットルの純水に、硝酸第二鉄19kgを20リットルの純水に、硝酸ビスマス22.9kgを濃硝酸6リットルを加えた純水30リットルに溶解させた後、混合して調製した硝酸塩水溶液を滴下した。引き続き20重量%シリカゾル溶液3.5kgおよび硝酸カリウム0.29kgを15リットルの純水に溶解した溶液を加えた。このようにして得られた懸濁液を加熱攪拌して蒸発乾固した後、乾燥粉碎した。得られた粉体を直径5mmの円柱状に成形し、460℃で6時間空気流通下焼成して触媒を得た。

【0067】

(実施例1)

図3に示す反応器を用いて、上記製造例で得た反応管にプロピレンから主としてアクロレインを生成させる触媒（組成Mo 12、Bi 1.2、Fe 1、Co 5、W 0.5、Si 1、K 0.06の組成モル比）を5.6m³充填し、プロピレン7vol%、酸素12.6vol%、水蒸気10vol%、窒素等70.4vol%の原料ガスを触媒接触時間が2秒となるように投入した。熱媒として硝酸カリウム50重量%、亜硝酸ナトリウム50重量%からなる熱媒を入口温度315℃で2900m³/hの軸流ポンプで循環させた。該反応器内において、穴あき円板形邪魔板が支持しない反応管と、円板形邪魔板が支持しない反応管とが存在する。

【0068】

反応器生成物排出口からの生成物を実測すると、プロピレン反応率は97.0%、アクロレイン選択率は84.7%であった。また、シミュレーションにより推定すると、プロピレン反応率は97.1%、アクロレイン選択率は84.7%であり、ほぼトレースできた。

【0069】

(比較例1)

実施例1において、穴あき円板型邪魔板の穴径を表1に示す径とした以外は、実施例1と同様にしてプロピレン反応率、アクロレイン選択率をシミュレーションした。結果を表1に示す。この結果、選択率、収率に変化なく、軸流ポンプ電力が5.4倍に増加した。なお、該反応器内において、穴あき円板形邪魔板が支持しない反応管は存在せず、円板形邪魔板が支持しない反応管は存在する。

【0070】

(比較例2)

穴あき円板型邪魔板が支持しない反応管を有しない反応器として、表1に示す中空径、穴あき円板型邪魔板の穴径を変更して、実施例1と同様に操作してアクロレインを得た。結果を表1に示す。なお、該反応器内において、穴あき円板形邪魔板が支持しない反応管は存在せず、円板形邪魔板が支持しない反応管は存在

する。この結果、選択率、収率に変化なく、軸流ポンプ電力が 1. 8 倍に増加した。

【 0 0 7 1 】

(実施例 2)

穴あき円板型邪魔板径、円板型邪魔板径、中央空間部径を実施例 1 と同一とし、円板型邪魔板径、反応器シェル径を表 1 に示す値とした以外は、実施例 1 と同様にしてアクロレインを得た。結果を表 1 に示す。なお、該反応器内において、穴あき円板形邪魔板が支持しない反応管は存在するが、円板形邪魔板が支持しない反応管は存在しない。この結果、軸流ポンプ電力比は、0. 9 7 であった。

【 0 0 7 2 】

(比較例 3)

穴あき円板型邪魔板の穴径を表 1 に示す値に変更した以外は、実施例 2 と同一の条件で操作してアクロレインを得た。結果を表 1 に示す。なお、該反応器内において、穴あき円板形邪魔板が支持しない反応管と、円板形邪魔板が支持しない反応管とは存在しない。

【 0 0 7 3 】

【表 1】

	実施例 1	実施例 2	比較例 1	比較例 2	比較例 3
反応器胴径(mm)	2700	3000	2700	2750	3000
中央空間部径(mm)	300	300	300	500	300
円板型邪魔板径(mm)	2400	2700	2400	2400	2700
穴あき円板型邪魔板穴径 (mm)	1100	1100	300	500	300
中空面積／胴面積	1.23	1.00	1.23	3.31	1.00
円板面積／胴面積	79.01	81.00	79.0	76.17	81.00
穴あき面積／胴面積	16.60	13.44	1.23	3.31	1.00
反応管長さ(mm)	3250	3250	3250	3250	3250
反応管本数	4100	4100	4100	4100	4100
反応管外径(mm)	29	29	29	29	29
反応管内径(mm)	25	25	25	25	25
反応管ピッチ(mm)	38	38	38	38	38
胴面積比	1.00	1.23	1.00	1.04	1.23
軸流ポンプ電力(kw)	83	80	450	152	446
軸流ポンプ電力比	1.0	0.97	5.4	1.8	5.4
70℃での反応率実測値(%)	97.0				
シミュレーション値(%)	97.1	97.3	96.9	96.9	97.0
アクリル選択率実測値(%)	84.8				
シミュレーション値(%)	84.7	84.4	84.9	84.9	84.9

【0074】

【発明の効果】

穴あき円板形邪魔板面積が支持しない反応管を配置したところ、軸流ポンプ電力を1/5.4に低減できた。しかも、選択率や目的生成物の収率を変化させずに軸流ポンプ電力を低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 従来の多管式反応器を示す概略説明図である。

【図 2】 本発明の反応器の穴あき円板型邪魔板、円板型邪魔板、反応管および空間部を示す図である。

【図 3】 循環装置を有する反応器の熱媒の循環経路を示す図である。

【図 4】 循環装置の一部から熱媒を取り出し、かつ循環装置に冷却後の熱媒を導入する反応器の概略図である。

【図 5】 環状導管の開口列を示す図である。

【図 6】 熱媒をダウンフローで流す場合の反応器の熱媒の流れを示す図である。

【図 7】 上部管板部のガス排出口の配置を示す図である。

【符号の説明】

- 1 反応器シェル
- 2 穴あき円板型邪魔板
- 3 円板型邪魔板
- 4 反応管
- 4 a 穴あき円板型邪魔板が支持しない反応管
- 4 b 円板型邪魔板が支持しない反応管
- 5 触媒
- 6 a 下部管板
- 6 b 上部管板
- 7 タイロッド
- 1 0, 1 0 a、1 0 b 熱媒
- 1 1 a、1 1 b 環状導管
- 1 2 熱媒取り出し口
- 1 3 熱媒排出ポット
- 1 4 ノズル
- 1 5、1 6 ガス排出用ノズル
- 1 7 ノズル
- 3 0 循環装置
- 3 1 熱媒循環口

3 2、3 2' 熱媒導入口

3 3 攪拌翼

3 4 熱媒排出口

3 5 ポンプ

3 6 ノズル

3 7 仕切板

5 0 原料供給口

5 1 生成物排出口

φ 1 穴あき円板型邪魔板穴径

φ 2 円板型邪魔板径

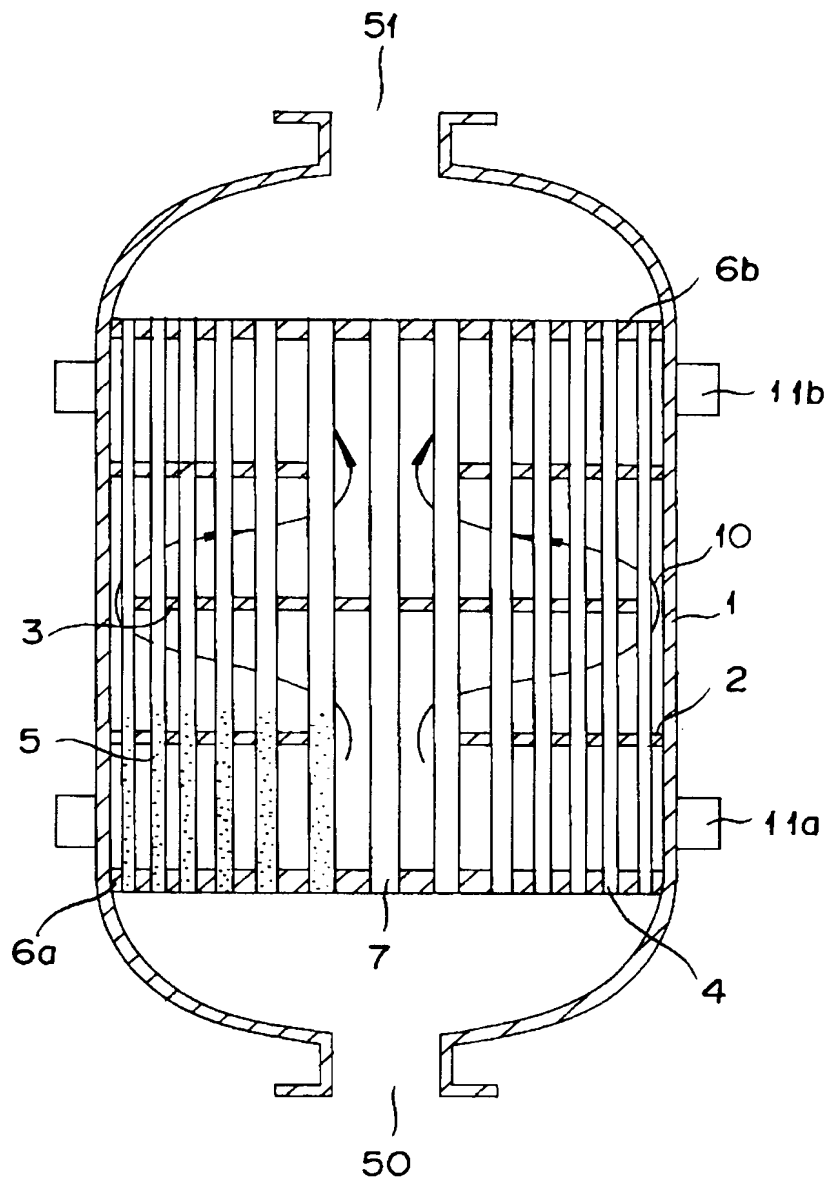
φ 3 反応器シェル内径

φ 4 空間部径

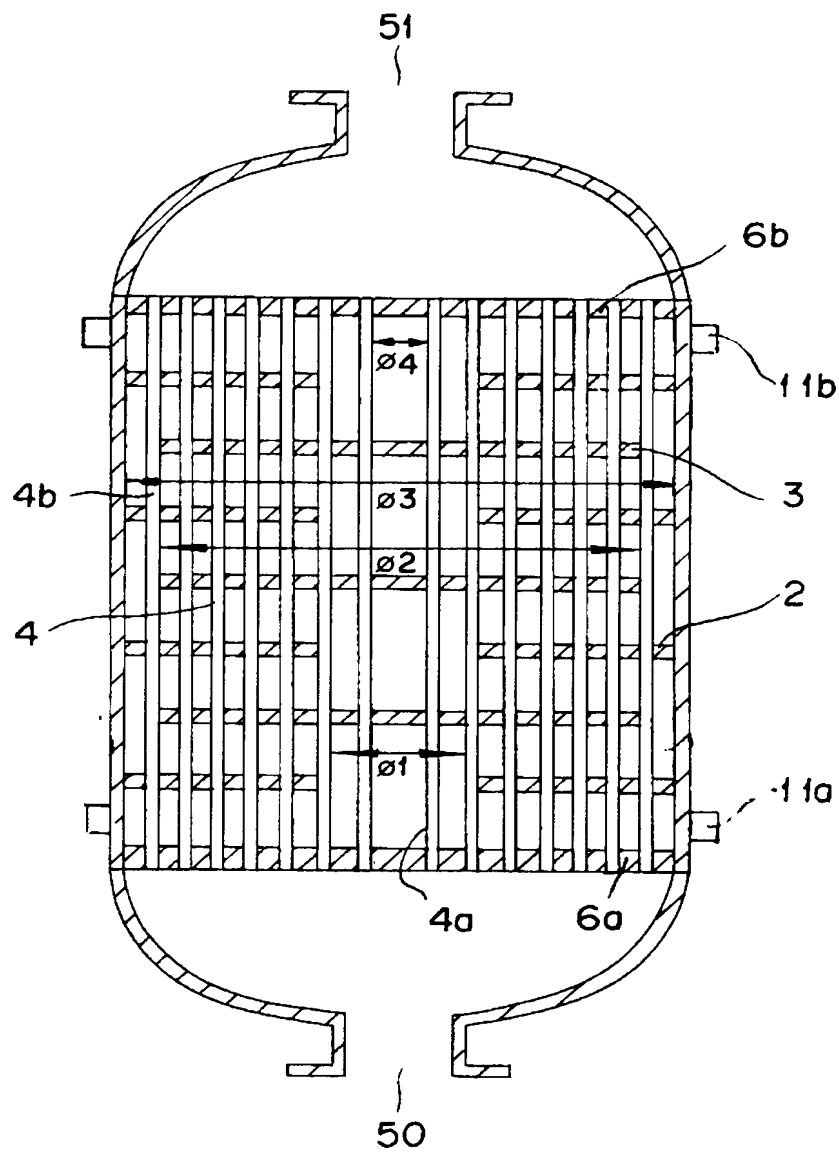
【書類名】

図面

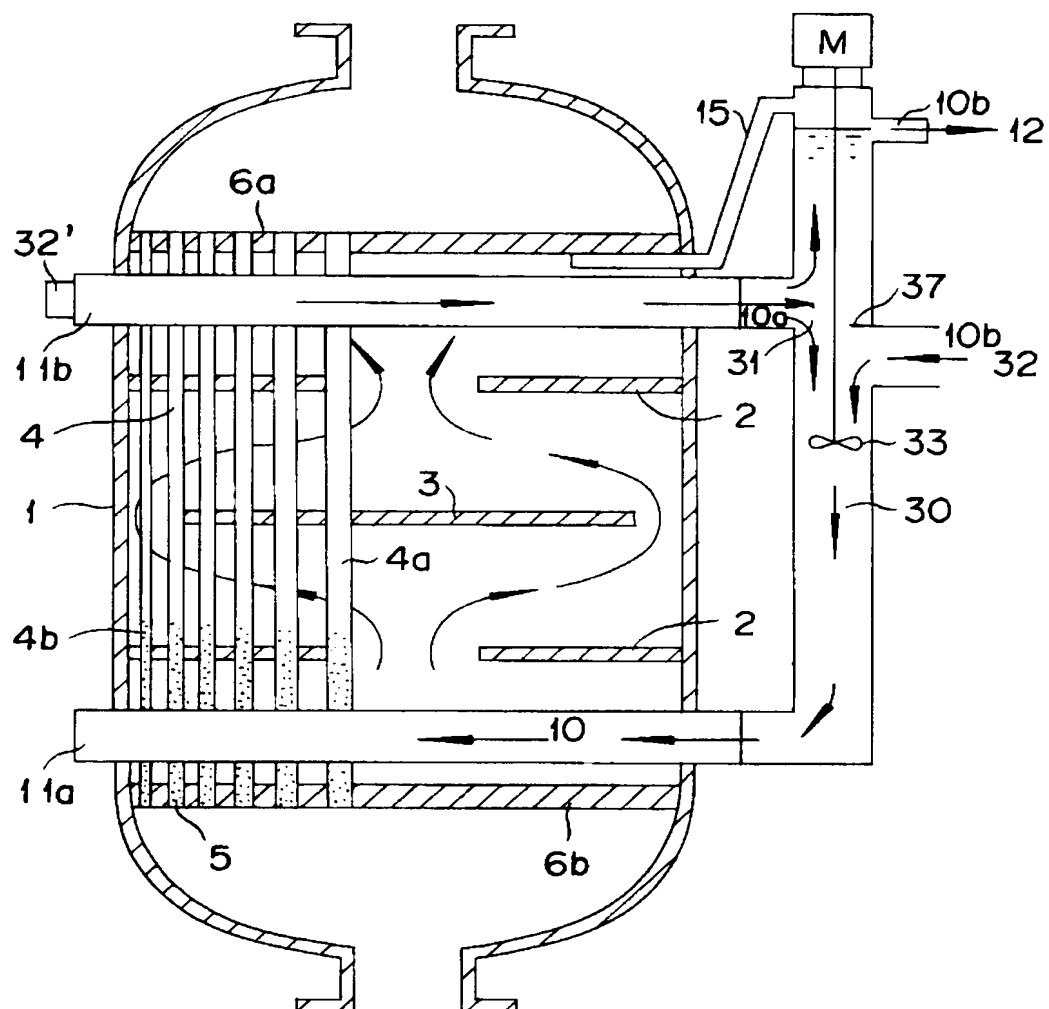
【図 1】



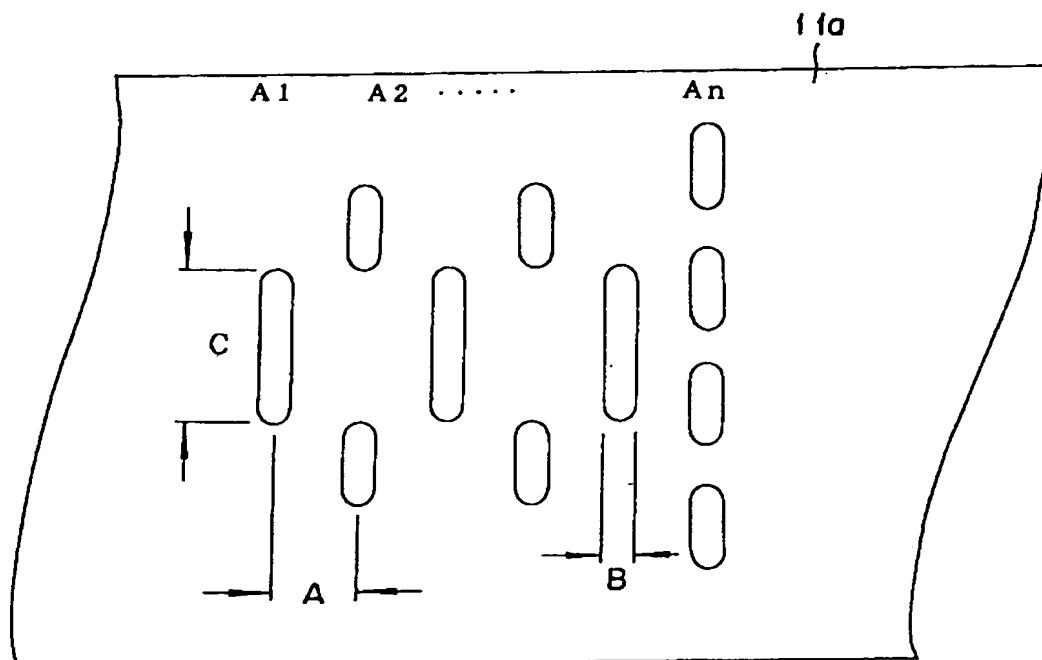
【図 2】



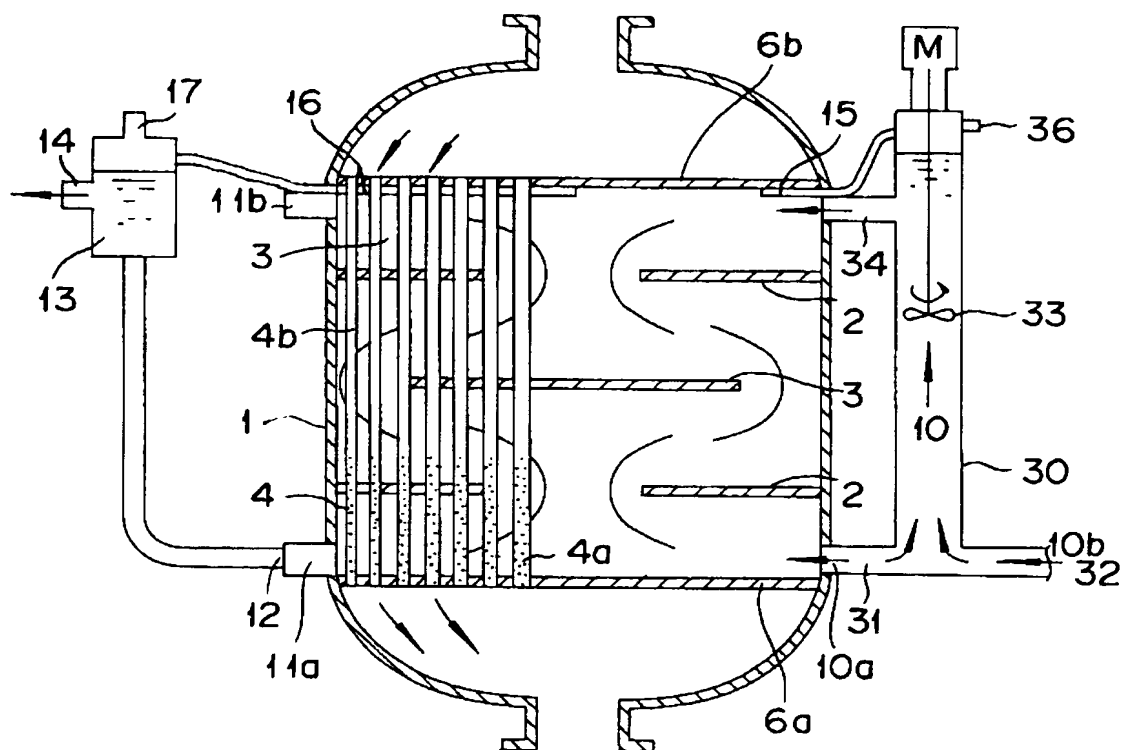
【図4】



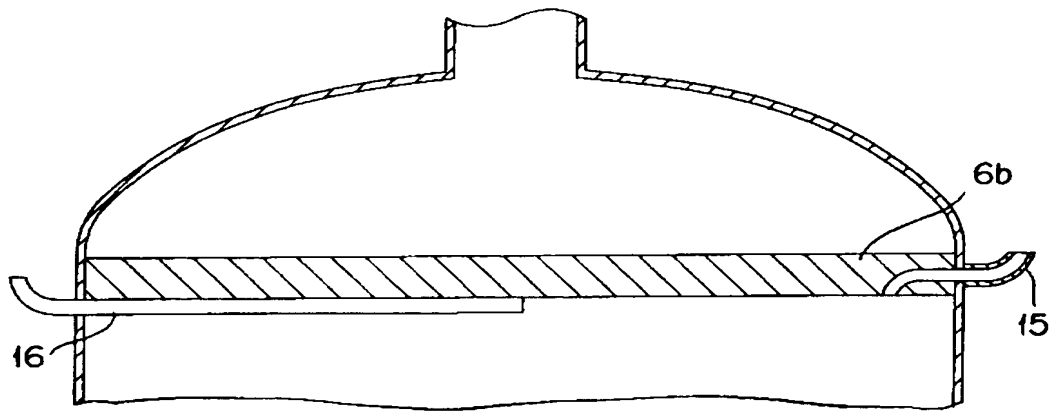
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 反応器内の熱媒の温度分布の低減およびホットスポットの発生を抑制する。

【解決手段】 穴あき円板型邪魔板と円板型邪魔板とを有する多管式反応器において、穴あき円板型邪魔板の穴部分にも反応管を有すると共に、反応器シェール中央に反応管を配置しない空間部を設ける。この様な配置によって、熱媒を移動させるための軸流動力を低減できる。しかも、各反応管は均一に熱除去され、ホットスポットの上昇もない。本発明によれば、プロピレンまたはイソブチレン含有ガスを接触気相酸化して（メタ）アクリル酸および/または（メタ）アクロレインを低エネルギーで製造することができる。

【選択図】 図 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 6 2 8]

1. 変更年月日	1 9 9 1 年 6 月 1 1 日
[変更理由]	名称変更
住 所	大阪府大阪市中央区高麗橋 4 丁目 1 番 1 号
氏 名	株式会社日本触媒